

Descriere:

Invenția se referă la tehnologia de fabricare a dispozitivelor pe semiconductori, în special la procedeele de obținere a nanostructurilor metalice.

5 Este cunoscut procedeul de obținere a nanostructurilor metalice prin injectarea sub presiune a unui material topit în vid în porii unui material poros [1].

Dezavantajul acestui procedeu este folosirea utilajului costisitor și a temperaturilor înalte, care pot duce la schimbarea nedorită a proprietăților materialului poros.

10 Mai este cunoscut procedeul de obținere a nanostructurilor metalice prin umplerea electrochimică cu metal a porilor unui templat poros de oxid de aluminiu [2]. Dezavantajul acestui procedeu este imposibilitatea obținerii nanotuburilor metalice, deoarece are loc umplerea completă a porilor templatului de la un capăt la altul.

Este cunoscut, de asemenea, procedeul de obținere a nanotuburilor metalice prin depunerea chimică a metalelor în interiorul porilor unui templat de semiconductor poros suprafața căruia este sensibilizată și activată catalitic [3].

15 Dezavantajul acestui procedeu este necesitatea folosirii multiplelor faze tehnologice.

Problema pe care o rezolvă invenția propusă constă în obținerea nanotuburilor metalice prin umplerea cu metal a porilor unui templat poros de semiconductor cu excluderea fazelor de sensibilizare și activare catalitică a suprafeței templatului.

20 Esența invenției constă în depunerea electrochimică a metalelor în porii unui templat de semiconductor poros. Noutatea invenției constă în aceea că depunerea electrochimică se realizează în condițiile aplicării tensiunii de impuls. Depunerea electrochimică poate fi efectuată timp de 5...30 min, la aplicarea impulsurilor de tensiune cu amplitudinea de 1,5...7 V, perioada de cel puțin 2 s și durata până la 0,5 s.

25 Rezultatul invenției constă în obținerea nanotuburilor metalice cu grosimea pereților controlată de parametrii electrice într-un singur proces de depunere electrochimică.

Invenția se explică prin figurile 1-3, care reprezintă:

- fig. 1, rezultatul analizei chimice efectuate prin media XRD (difracția x-roentgen) la instalația "Oxford Instrument Analytical" pentru proba cu depunere electrochimică în decurs de 20 min;

30 - fig. 2, rezultatul analizei chimice efectuate prin media XRD la instalația "Oxford Instrument Analytical" pentru proba cu depunere electrochimică în decurs de 10 min;

- fig. 3, rezultatul analizei chimice de-a lungul nanotuburilor efectuate prin metoda XRD la instalația "Oxford Instrument Analytical".

Exemplu de realizare a invenției

35 În calitate de templat poros semiconductor au fost folosite straturi nanoporoase n-InP cu diametrul porilor de 70 nm și grosimea pereților de 30 nm, obținute prin corodarea electrochimică a substraturilor n-InP în condițiile formării unei rețele bidimensionale hexagonale a porilor.

În calitate de soluție chimică a fost folosită soluția apoasă de AgNO₃ 10%.

40 Depunerea electrochimică a argintului în pori a fost efectuată la temperatura de cameră prin aplicarea impulsurilor de tensiune cu amplitudinea de 2,5 V, perioada de 2 s și durata impulsurilor de 0,5 s. Rezultatul analizei chimice efectuate prin metoda XRD la instalația "Oxford Instrument Analytical" pentru probele cu depunere electrochimică în decurs de 20 și 10 min este indicat în figurile 1 și 2, respectiv. Cunoscând diametrul porilor și grosimea pereților templatului semiconductor și ținând cont de rezultatele analizei chimice putem calcula grosimea nanotuburilor de argint. Pentru durata procesului electrochimic de 20 min grosimea nanotuburilor de argint este de aproximativ 2,4 nm, iar pentru durata procesului electrochimic de 10 min grosimea nanotuburilor de argint este de aproximativ 1,2 nm. 45 Uniformitatea grosimii pereților nanotuburilor de argint de-a lungul nanotuburilor este demonstrată de rezultatul analizei chimice în adâncimea porilor efectuate prin metoda XRD la instalația "Oxford Instrument Analytical" (figura 3).

50

(57) Revendicări:

- 5 1. Procedeu de obținere a nanotuburilor metalice care constă în depunerea electrochimică a metalelor în porii semiconductorului poros, **caracterizat prin aceea că** depunerea electrochimică se desfășurează în condițiile aplicării tensiunii de impuls.
2. Procedeu de obținere a nanotuburilor metalice, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** depunerea electrochimică se desfășurează timp de 5...30 min.
- 10 3. Procedeu de obținere a nanotuburilor metalice, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** se aplică impulsuri de tensiune cu amplitudinea de 1,5...7,0 V, cu perioada de cel puțin 2 s și durata până la 0,5 s.

15

(56) Referințe bibliografice:

1. US 6359288 B 2002.03.19
2. D. Routkevitch, et al. Nonlithographic nano-wire arrays: fabrication, physics, and device applications. IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 43, nr. 10, 1996, p. 1646 -1658
3. MD2804 G2 2005.06.30

Șef Secție: NEKLIUDOVA Natalia

Examinator: COJOCARU Ala

Redactor: LOZOVANU Maria

MD 3088 G2 2006.06.30

5

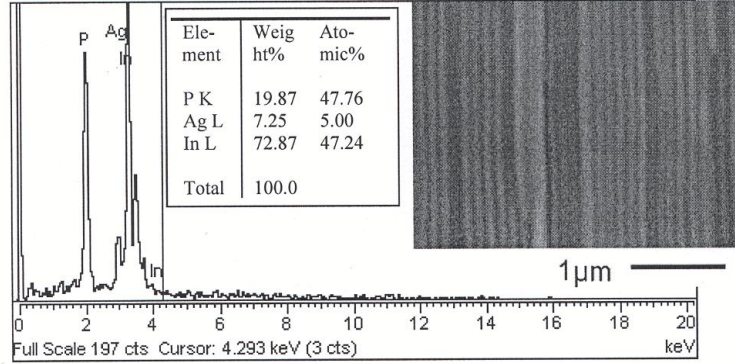


Fig. 1

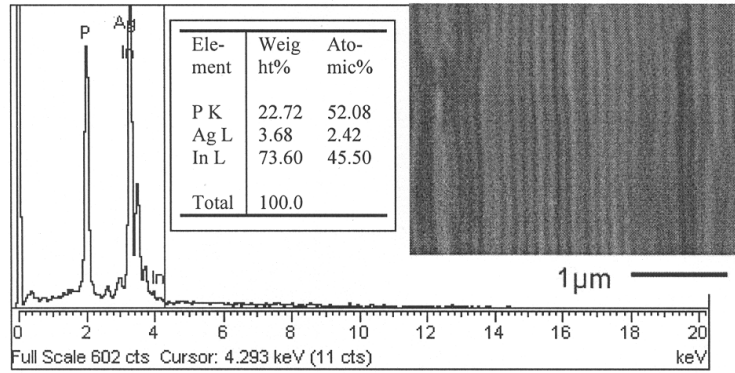


Fig. 2

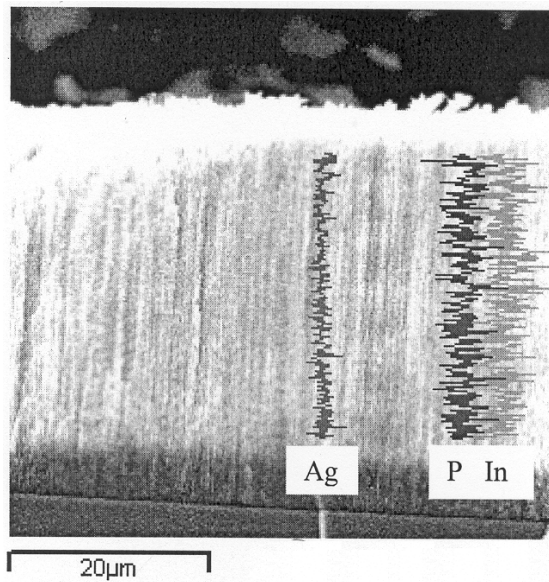


Fig. 3